

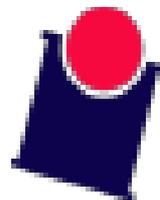
エイエルエステクノロジー・インフォビオン スパッタ装置カタログ

We can supply the HQ sputtering system by reasonable price.



株式会社 エイエルエステクノロジー

Co-operate with



DISPLAY & PLASMA TECHNOLOGY

INFOVION

INFOVION Inc.

INFOVION's
COMBI-IBD

INFOVION's Combinatorial Ion Beam Sputter System
can dramatically alter the existing paradigm for
discovering new materials.



イオンビームスパッタ装置
コンビトリナル仕様

当社では従来の複合スパッタ装置に加えてスパッタ専用装置の事業を強化することとし、韓国ソウル市に拠点をもつインフォビオン社(Infovion)と連携し、同社の優れたスパッタ装置を日本の市場に販売展開をしております。

About インフォビオン

(1) インフォビオン社のご紹介

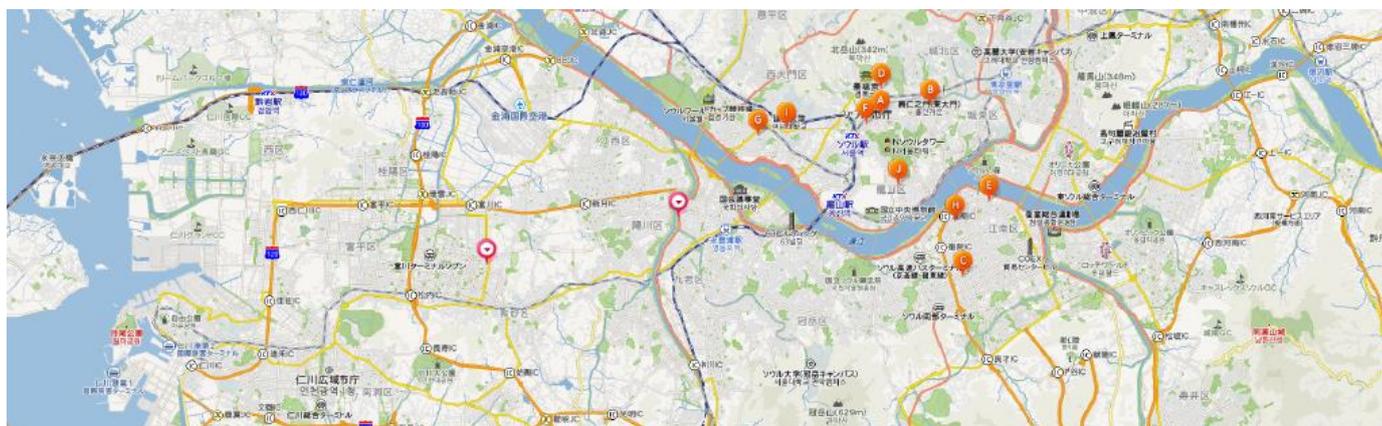
インフォビオン社は韓国真空機器メーカーとして大学研究向け小型装置から大型のインライン装置やクラスタ装置まで幅広く手掛けております。

- ・製品例 イオンガン、EBアシストガン、カルーセル大型バッチスパッタ、インライン製膜装置、クラスタ製膜装置、ALD装置など幅広い分野で活動。
- ・得意分野 イオン、電子を扱う高い固有技術レベルを備えております。

(2) 所在地

住所 5-3,Mullae-dong 5-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-095, Korea、 <http://www.infovion.com>

韓国ソウル市の中央部に位置し政治経済の中心地である汝矣島(国会議事堂があるエリア)から5km以内に位置しています。(金浦国際空港から車で30分以内、ソウル駅から最寄駅まで地下鉄で30分以内)



韓国地図 KONEST から引用

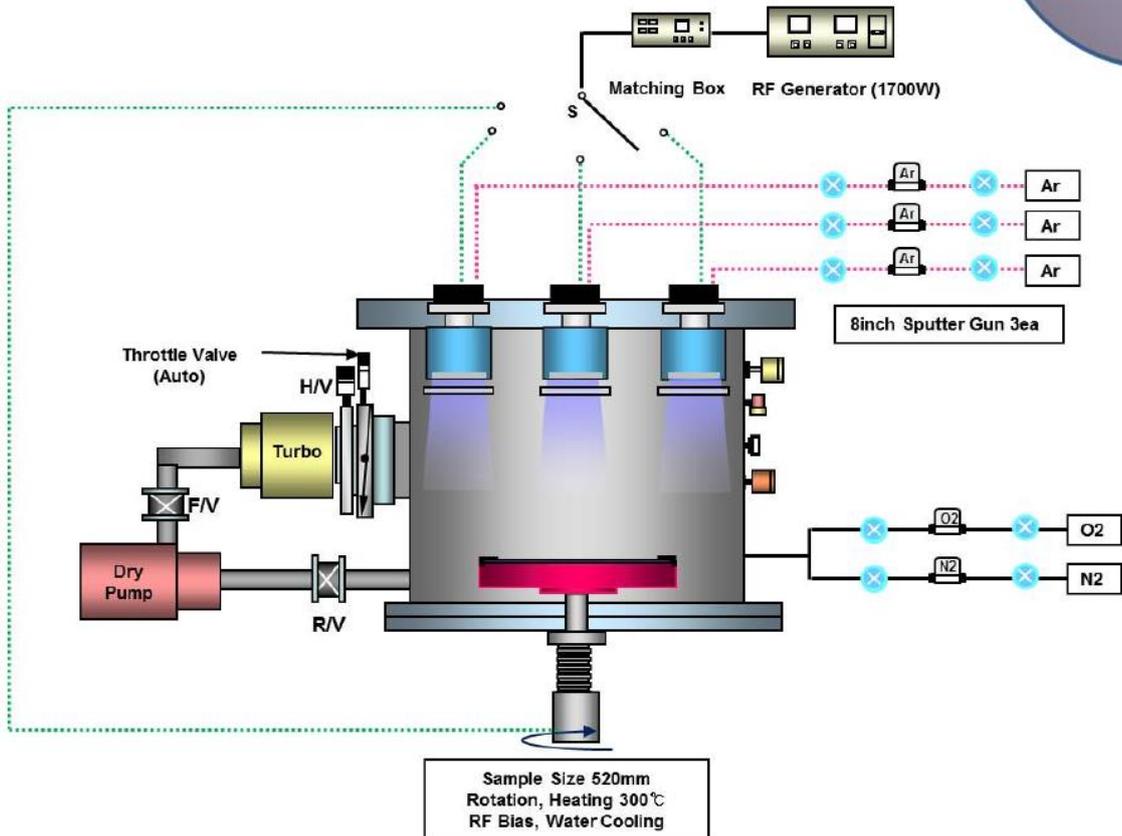
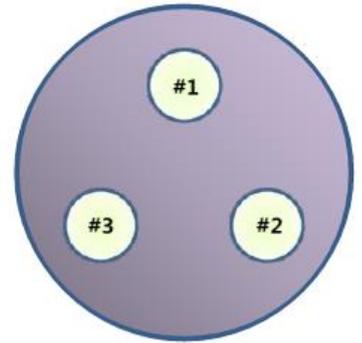
据え付け、調整、お引渡し等

- ・当社工場(日本)にてお客様による立会い検査が可能です。
基本的にはインフォビオン社の工場(ソウル)での立ち合いをお願いしております。
- ・弊社の技術者(日本人)が出張して据え付け調整お引渡しをさせていただきます。

保証、アフターサービス

- (1) 品質保証 1年間の無償保証期間
- (2) 無償保証終了後も当社(日本)の技術者が責任を持って修理等をさせていただきます。

型番	S-ISM-1830
分類	平行平板型スパッタリング装置(Φ8インチカソードx 3基)
用途	小規模生産用・研究用

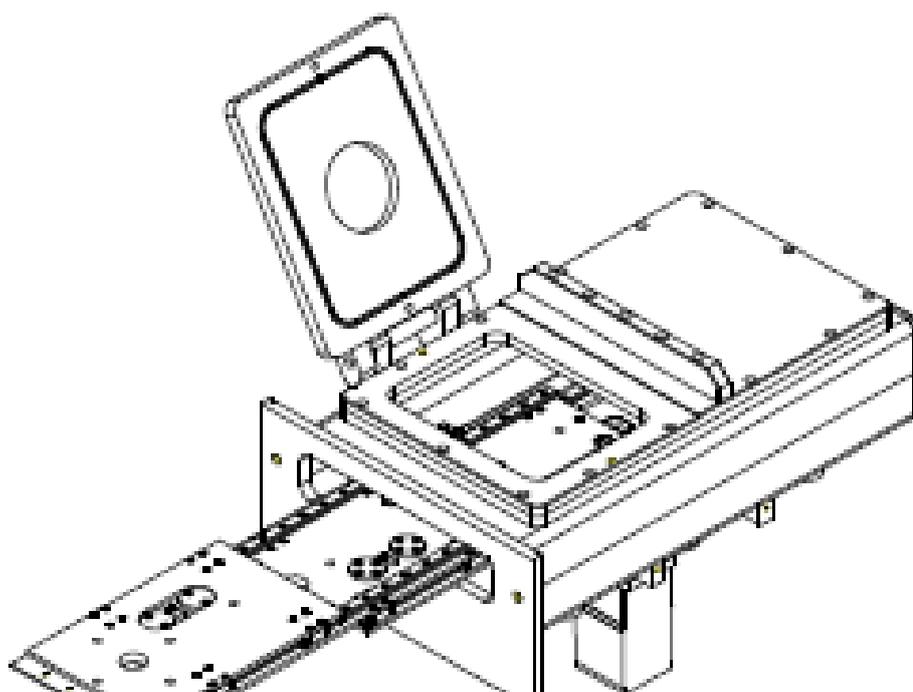


主要仕様

	主要構成	仕様
スパッタ室	マルチカソード	8インチプレーナマグネトロンカソード x 3基
	スパッタ電源	RF,13.56MHz、1700W x 1基、カソード切り替器
	マッチング	オートマッチング x 1基
	シャッター	個別シャッター x 3式
	基板ホルダー	ホルダー直径 Φ520mm
		水冷、基板加熱(300°C、PID制御)
		基板回転5 rpm 磁性流体シール
	逆スパッタ	オプション
	成膜性能	Φ400mm内にて±10%
排気系	主排気ポンプ	ターボ分子ポンプ 2.400L/sec(N2)
	粗びきポンプ	ドライポンプ
	スパッタ圧力調整	スロットルバルブ/自動圧力調整機構付
	真空性能	10 ⁻⁷ Torr台
ガス導入	ガスの種類	Ar(100sccm) (O ₂ 、N ₂ など)
	制御バルブ	マスフローコントローラー
制御関係	大型スクリーンディスプレイ	キーボード入力
	製膜操作	レシピによる全自動
	排気操作	自動

オプション

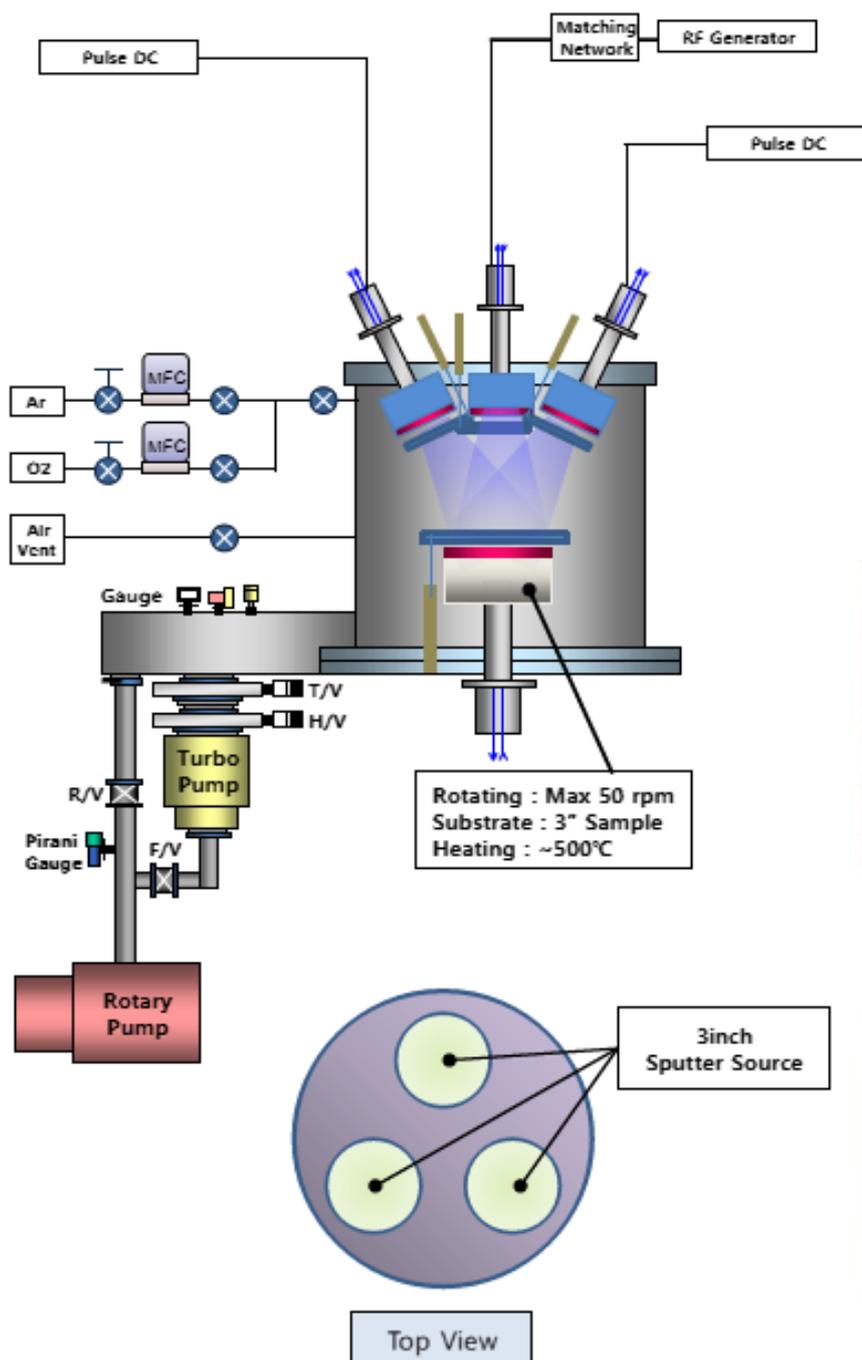
- ・ロードロックシステム
- ・スパッタリング電源(RF/DC)
- ・プロセスガスの種類、流量
- ・その他、お客様のご要求に応じて対応させていただきます。



ロードロックシステム

型番	S-IS-1330
分類	スパッタリング装置(Φ3インチカソードx 3基、Focusing 配置)
用途	研究用(半導体、新材料開発、センサー開発など)

特徴 レシピに基づいた自動製膜が可能です。
 3カソード同時放電が可能
 積層膜、混合膜が可能(組成制御可能)
 コンパクトデザイン



Φ 3 インチカソード (斜め配置)



基板ホルダーΦ 3 インチ基板対応

主要仕様

	主要構成	仕様
スパッタ室	マルチカソード	3インチプレーナマグネトロンカソード x 3基 (Focusing配置)
	スパッタ電源	RF, 13.56MHz, 600W x 1基、パルスDC x 2基
	マッチング	オートマッチング x 1基
	シャッター	個別シャッター(カソードシャッター3基、基板シャッター1基)
	基板ホルダー	サンプルホルダー 直径 Φ3インチ
		水冷、基板加熱(500°C、PID 制御)
		基板回転50 rpm 磁性流体シール
	逆スパッタ	オプション
	成膜性能	Φ3インチにて±10%
排気系	主排気ポンプ	ターボ分子ポンプ 1, 100L/sec(N2)
	あらびきポンプ	ロータリーポンプ
	スパッタ圧力調整	スロットルバルブ / 自動圧力調整機構付
	真空性能	10 ⁻⁷ Torr台
ガス導入	ガスの種類	Ar: 50sccm / O ₂ : 20sccm
	制御バルブ	マスフローコントローラー
制御関係	大型スクリーンディスプレイ	キーボード入力
	製膜操作	レシピによる全自動
	排気操作	自動



他の装置の例

(上記カタログ装置はほんの一例です。詳細はお問合せください。)

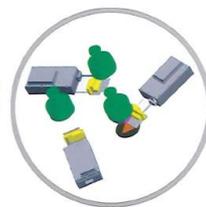
INFOVION's Multi Layer E-beam Evaporator System

INFOVION's E-beam Evaporator System is Highly
Reliable for Wide Range of Production
and Research Applications



INFOVION's Ion Beam Sputter Deposition System

INFOVION's IBSD System has Unique
Characteristics, Including Process Optimization &
Versatility that is Suitable for Difficult Applications



INFOVION's COMBI-Sputter

INFOVION's Combinatorial Sputter System can
dramatically accelerate the discovery of ideal
compound and optimization process.

